

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成23年10月20日(2011.10.20)

【公表番号】特表2010-537868(P2010-537868A)

【公表日】平成22年12月9日(2010.12.9)

【年通号数】公開・登録公報2010-049

【出願番号】特願2010-524186(P2010-524186)

【国際特許分類】

B 29 C 33/38 (2006.01)

B 29 C 33/64 (2006.01)

C 08 G 77/04 (2006.01)

【F I】

B 29 C 33/38

B 29 C 33/64

C 08 G 77/04

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月31日(2011.8.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

加工用成形型を形成する方法であって、

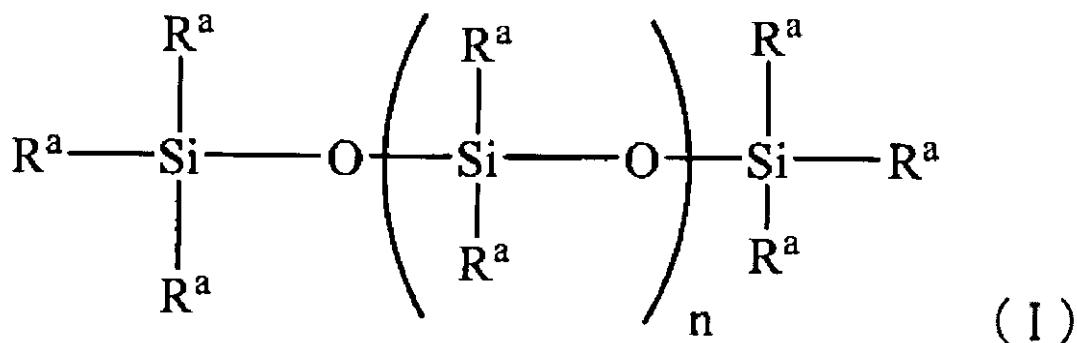
少なくとも第1の構造化表面を有する基材を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、

前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、

式Iの液体シリコーン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、

前記式Iは、

【化1】



であり、

式中、 R^a は独立して、H、OH、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ n は3~3000の整数である、工程と、

シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記基材の前記第1の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積し、前記加工用成形型を形成する、工程と、を含む方法。

【請求項2】

成形物品を形成する方法であって、

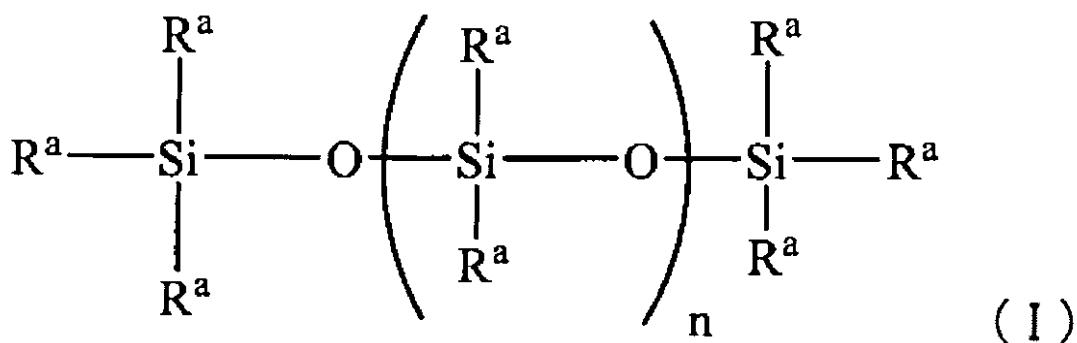
少なくとも第1の構造化表面を有する未処理の加工用成形型を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、

前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、

式Iの液体シリコーン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、

前記式Iは、

【化2】



であり、

式中、 R^a は独立して、H、OH、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつ n は3~3000の整数である、工程と、

シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記第1の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積して、前記加工用成形型を形成する、工程と、

、
第3世代の前駆体を前記加工用成形型の前記第1の表面の少なくとも一部分と接触させて、前記加工用成形型の前記第1の構造化表面の反転である成形物品を形成する工程と、を含む方法。

【請求項3】

成形物品を連続して形成する方法であって、

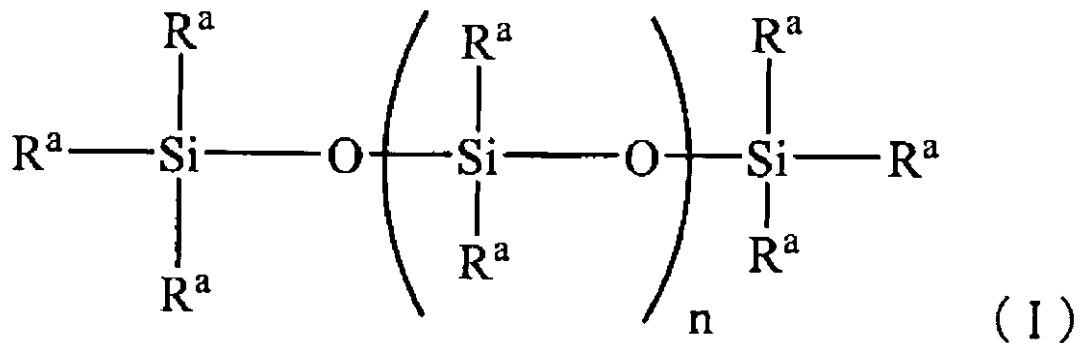
少なくとも第1の構造化表面を有する未処理の加工用成形型を、チャンバ内の電極の近くに配置する工程と、

前記電極に電力を供給してプラズマを発生させる工程と、

式Iの液体シリコーン分子の蒸気を前記プラズマに導入する工程であって、

前記式Iは、

【化3】

であり、式中、R^aは独立して、H、OH、アルキル、アリール、又はアルコキシであり、かつnは3～3000の整数である、工程と、シリコーン含有ポリマーを含む剥離層を堆積させる工程であって、前記剥離層を前記第1の構造化表面の少なくとも一部分上に堆積して、前記加工用成形型を形成する、工程と、前記加工用成形型を備える連続ツールを形成する工程と、第3世代の前駆体を前記加工用成形型の前記第1の表面の少なくとも一部分と連続して接触させて、前記加工用成形型の前記第1の構造化表面の反転である成形物品を形成する工程と、を含む方法。